



第34回光学薄膜研究会開催のご案内

2019年度 第3回 光学薄膜特別セミナー、および光学薄膜研究会を下記の通り開催致します。皆様のご参加をお待ちしております。

◆日時 : 2019年10月15日(火)

◆場所 : 機械振興会館 (〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8)

1. 若手の会 基礎講座(10:00~12:00)

受付 : 9:30~10:00

題目 : 「光学薄膜形成用蒸着装置の安定稼働のために」

講師 : 株式会社昭和真空 営業部 瀧本 昌行 氏

部屋 : 機械振興会館地下3階 会議室 1(B3-1)

定員 : 約 30 名 (*事前申込み願います)

対象者 : 45 歳以下の研究会会員

参加費 : 無料

概要 : **若手のメンバー向けに**第 17 回研究会で講演しました“光学薄膜形成用蒸着装置の安定稼働のために”の資料を再度ご説明させていただきます。随時質

疑応答・フリーディスカッションをさせていただきます。

2. 光学薄膜研究会 研究会 (13:15~17:00)

受付 : 12:30~13:15

部屋 : 地下2階ホール

研究会 : 13:15~17:00

定員 : 約 200名

参加費:【会 員】 無料(法人会員、個人会員)

但し、法人会員で3名/口を超える場合は5,000円/人

【非会員】 5,000円/人

3. 懇親会(17:00~19:00)

受付 : 研究会受付時に同時にお申込下さい。

懇親会のみの参加者は懇親会開始前に受け付け致します。

参加費:4,000円/人

場所 : 地下3階 ニュートーキョー

4. 【研究会プログラム】

4.1 代表挨拶 東海大学 室谷教授(13:15~13:20)

4.2 『ISO19962 光散乱の詳細説明&ISO9211-8 光学部品のレーザー耐性に関して』

(13:20-14:05)

「光学部品による散乱光の分光測定方法の規格について ~JIS B 7081 と ISO 19962~」

株式会社日立ハイテクサイエンス アプリケーション開発センタ 栗田 浩二 様

光学部品による散乱光の分光測定方法の規格 JIS B 7081 が 2017/9、ISO 19962 が 2019/5 に公示されました。この規格で規定される分光光度計の概要や 2 つの規格の差異について説明します。

「ISO9211-8 光学部品のレーザー耐性に関して」

株式会社ニコン 生産本部 加工技術開発部 第三開発課 逢坂 昌宏 様

光学コーティングに関する国際規格として ISO9211 シリーズがある。レーザー光学に使用されるコーティングの最低限の要求事項となる ISO9211-8 が制定された。ISO9211-8 の内容について報告する。

4.3 『OIC 2019 参加報告』(14:05-14:50)

株式会社ニコン 生産本部 加工技術開発部 第三開発課 真垣 葉子 様

Optical Interference Coating (以下 OIC) は 3 年に 1 度、北米で開催される光学干涉薄膜の学会である。6 月 3 日~6 日の 5 日間にわたり、米国ニューメキシコ州で開催された OIC2019 に参加したので、その概要について報告する。

----- (休憩 14:50~15:05) -----

4.4 『Optical Characteristics of Low-Refractive-Index Optical Thin Films Fabricated by Sputtering and Electron-Beam Vacuum Deposition』(15:05-15:20)

東海大学 速水 舞様

電子ビーム蒸着とスパッタリング併用プロセスにより成膜した低屈折率光学薄膜の特性を光学特性を中心に報告する。

4.5 『Mechanical Properties of Low-Refractive-Index SiO₂ Optical Films』

(15:20-16:35)

東海大学 呂 翔宇 様

電子ビーム蒸着とスパッタリング併用プロセスにより成膜した低屈折率 SiO₂ 光学薄膜の機械的特性を中心に報告する。

4.6 『「ステップ ND フィルター」の作製結果』(16:35-16:50)

朝日分光株式会社 部品事業部 成膜部 基礎研究グループ 佐藤 一輝 様
マグネトロンスパッタリング法でステップ状の分光透過率をもつ光学フィルターを作製し、設計値に近似した実測値を得た。高度な分光特性をもつ光学フィルターを歩留まり良く作製可能であり、様々な分野で応用が期待される。

4.7 『SiO 層による Ge/Na₃AlF₆ から成る遠赤外線フィルターの剥離防止』(15:50-16:05)

朝日分光株式会社 部品事業部 成膜部 基礎研究G 室 幸市 様
遠赤外線フィルター(Ge/Na₃AlF₆)を構成する Na₃AlF₆ 超厚膜に対して、SiO 層による剥離抑制の効果を見出した。このフィルターを用いて、サーマルカメラにてガス(HFC)イメージングを行った。

4.8 『膜応力による基板の反りの定量的計算について』(16:05-16:20)

東海光学株式会社 開発部 主席 杉浦 宗男 様
成膜により基板が反ることは良く知られています。予め成膜後の反りを計算するためには、基板と膜の機械的、熱的物性など多数のパラメータが必要とされ、精度良く求めるのは容易ではありません。本研究では、簡易的かつ定量的に反り予測する計算の枠組みを提案しました。

4.9 『揺動自転運動による膜厚均一性および成膜粒子入射角均一性の向上』(16:20-16:35)

株式会社トプコン 製品開発本部 設計支援部 化学・薄膜技術課 エキスパート 秋葉 正博 様
スパッタリング成膜において、自転回転に対して揺動運動を加えることにより膜厚均一性および成膜粒子の入射角均一性を向上させる技術について報告する。

4.10『ビューラー株式会社 会社紹介』(16:35-16:45)

4.11『株式会社シンクロン 会社紹介』(16:45-16:55)

4.12 事務局からのご案内(16:55-17:00)

***注:プログラムは、諸般の事情により変更する場合がございます。**

5. 参加申込: 光学薄膜研究会 事務局 齊藤 (info-otfse@otfse.org)宛

メールにて

- ① 若手の会基礎講座の申込有無:
- ② 研究会参加の有無 :
- ③ 懇親会参加の有無 :
- ④ 氏名, 会社名, 部署:
- ⑤ メールアドレス :

をご連絡ください。申し込み締め切り10月8日(火)です。

※出来るだけ早いお申込にご協力戴けますと助かります。

以下、ご注意とお願いです。

- ・申込は①～⑤すべてにご記載をお願いします。未記載がありますと確認連絡が必要となりますので、お手数ですが、事務局の負担軽減にご協力お願いいたします。
代表者がお申込の場合も全員分のご記載をお願いします。
- ・講演資料は、10月8日頃にHP 会員ページにアップしますので、前にプリントアウトしご持参ください。当日の印刷物配布は非会員の方のみです。
(非会員の方で当日参加されます方は、当日に白黒印刷の資料をお渡します。)

以上

機械振興会館へのアクセス

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8

<http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/access.html>

- ・東京メトロ日比谷線神谷町駅下車 徒歩 8 分
- ・都営地下鉄三田線御成門駅下車 徒歩 8 分
- ・都営地下鉄大江戸線赤羽橋駅下車 徒歩 10 分
- ・都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅下車 徒歩 10 分
- ・JR 浜松町駅下車 徒歩 15 分

